(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107597523 A
(43)申请公布日 2018.01.19

(21)申请号 201711055168.2

(22)申请日 2017.11.01

(71)申请人 苏州普莱特环保新材料有限公司
地址 215236 江苏省苏州市吴江区桃源镇铜罗富乡大道88号

(72)发明人 李炳兴

(74)专利代理机构 苏州国诚专利代理有限公司 32293
代理人 韩凤

(51)Int.Cl.
B05D 3/00(2006.01)
B05D 3/02(2006.01)
B05D 3/06(2006.01)
B05D 5/06(2006.01)
B05D 7/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种岩彩基板及其底涂工艺

(57)摘要

本发明提供一种岩彩基板及其底涂工艺，其中，所述底涂工艺包括如下步骤：S1、提供需要进行底涂的岩彩基板；S2、第一次表面抛光；S3、第二次表面抛光；S4、uv漆渗透处理；S5、第一次干燥；S6、第二次干燥；S7、水性加固处理；S8、第一次底涂；S9、对第一次底涂之后的岩彩板基板进行第四次流平干燥处理，待其完全干燥后，控制岩彩板基板进行换向，并对换向后的岩彩板基板进行第二次底涂；S10、对第二次底涂之后的岩彩板基板进行烘干，并下料得到底涂的岩彩基板。本发明能够对岩彩基板进行有效的加工处理，使其表面满足后续的加工需求，同时，本发明还具有连续性好、加工效率高的优点。

CN 107597523 A

1.一种岩彩基板的底涂工艺，其特征在于，所述底涂工艺包括如下步骤：

S1、提供需要进行底涂的岩彩基板；

S2、对提供的岩彩基板进行第一次表面抛光；

S3、对第一次表面抛光的岩彩基板进行第二次表面抛光；

S4、对所述岩彩基板进行uv漆渗透处理；

S5、对渗透处理之后的岩彩基板进行第一次干燥；

S6、对渗透处理之后的岩彩基板进行第二次干燥；

S7、待岩彩板基板表面完全干燥后，对岩彩板基板进行水性加固处理；

S8、对水性加固之后的岩彩板基板进行第三次干燥处理，待其完全干燥后，进行第一次底涂；

S9、对第一次底涂之后的岩彩板基板进行第四次流平干燥处理，待其完全干燥后，控制岩彩板基板进行换向，并对换向后的岩彩板基板进行第二次底涂；

S10、对第二次底涂之后的岩彩板基板进行烘干，并下料得到底涂的岩彩基板。

2.根据权利要求1所述的岩彩基板的底涂工艺，其特征在于，通过上料机完成所述岩彩基板的上料。

3.根据权利要求1所述的岩彩基板的底涂工艺，其特征在于，通过砂光机完成所述第一次表面抛光和第二次表面抛光。

4.根据权利要求1所述的岩彩基板的底涂工艺，其特征在于，进行uv漆渗透处理时，uv渗透用量为60±5G/m^2。

5.根据权利要求1所述的岩彩基板的底涂工艺，其特征在于，所述第一、三、四次干燥为流平干燥，所述流平干燥的干燥温度为60-70℃。

6.根据权利要求1所述的岩彩基板的底涂工艺，其特征在于，所述第二次干燥为uv干燥，采用5灯uv干燥机进行uv干燥，所述5灯uv干燥机的干燥能量为1600-1700J。

7.根据权利要求1所述的岩彩基板的底涂工艺，其特征在于，通过水性加固喷涂设备进行水性加固处理。

8.根据权利要求1所述的岩彩基板的底涂工艺，其特征在于，通过底漆涂布机进行第一次底涂和第二次底涂。

9.根据权利要求1所述的岩彩基板的底涂工艺，其特征在于，通过烘房进行对第二次底涂之后的岩彩板基板进行烘干，所述烘房的温度为55-65℃。

10.一种岩彩基板，其特征在于，所述岩彩基板由权利要求1-9任一项所述的底涂工艺而获得。

一种岩彩基板及其底涂工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及岩彩板生产领域，尤其涉及一种岩彩基板及其底涂工艺。

背景技术

[0002] 岩彩板是一种装饰板材，其具有良好的保温隔热功能，且板身轻巧。现有的岩彩板生产过程中，首先需要对原始基板进行一系列的加工处理，以使其表面符合后续的加工需求。然而，现有的岩彩板的原始基板在加工工艺中，通常仅进行简单的处理，且对岩彩板的原始基板的处理缺乏连续性。

[0003] 因此，针对上述问题，本发明提出进一步的解决方案。

发明内容

[0004] 本发明旨在提供一种岩彩基板及其底涂工艺，以克服现有技术中存在的不足。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明的技术方案是：

[0006] 一种岩彩基板的底涂工艺，其包括如下步骤：

[0007] S1、提供需要进行底涂的岩彩基板；

[0008] S2、对提供的岩彩基板进行第一次表面抛光；

[0009] S3、对第一次表面抛光的岩彩基板进行第二次表面抛光；

[0010] S4、对所述岩彩基板进行uv漆渗透处理；

[0011] S5、对渗透处理之后的岩彩基板进行第一次干燥；

[0012] S6、对渗透处理之后的岩彩基板进行第二次干燥；

[0013] S7、待岩彩板基板表面完全干燥后，对岩彩板基板进行水性加固处理；

[0014] S8、对水性加固之后的岩彩板基板进行第三次干燥处理，待其完全干燥后，进行第一次底涂；

[0015] S9、对第一次底涂之后的岩彩板基板进行第四次流平干燥处理，待其完全干燥后，控制岩彩板基板进行换向，并对换向后的岩彩板基板进行第二次底涂；

[0016] S10、对第二次底涂之后的岩彩板基板进行烘干，并下料得到底涂的岩彩基板。

[0017] 作为本发明的岩彩基板的底涂工艺的改进，通过上料机完成所述岩彩基板的上料。

[0018] 作为本发明的岩彩基板的底涂工艺的改进，通过砂光机完成所述第一次表面抛光和第二次表面抛光。

[0019] 作为本发明的岩彩基板的底涂工艺的改进，进行uv漆渗透处理时，uv渗透用量为$60\pm5G/m^2$。

[0020] 作为本发明的岩彩基板的底涂工艺的改进，所述第一、三、四次干燥为流平干燥，所述流平干燥的干燥温度为60-70℃。

[0021] 作为本发明的岩彩基板的底涂工艺的改进，所述第二次干燥为uv干燥，采用5灯uv干燥机进行uv干燥，所述5灯uv干燥机的干燥能量为1600-1700J。

[0022] 作为本发明的岩彩基板的底涂工艺的改进，通过水性加固喷涂设备进行水性加固处理。

[0023] 作为本发明的岩彩基板的底涂工艺的改进，通过底漆涂布机进行第一次底涂和第二次底涂。

[0024] 作为本发明的岩彩基板的底涂工艺的改进，通过烘房进行对第二次底涂之后的岩彩板基板进行烘干，所述烘房的温度为55-65℃。

[0025] 为解决上述技术问题，本发明的另一技术方案是：

[0026] 一种岩彩基板，其由如上所述的底涂工艺而获得。

[0027] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：本发明能够对岩彩基板进行有效的加工处理，使其表面满足后续的加工需求，同时，本发明还具有连续性好、加工效率高的优点。

具体实施方式

[0028] 下面将结合本发明实施例对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0029] 本发明的岩彩基板的底涂工艺包括如下步骤：

[0030] S1、提供需要进行底涂的岩彩基板。

[0031] 其中，可提供适于岩彩基板上料的上料机完成岩彩基板的上料。

[0032] S2、对提供的岩彩基板进行第一次表面抛光。

[0033] S3、对第一次表面抛光的岩彩基板进行第二次表面抛光。

[0034] 其中，所述第一次表面抛光与第二次表面抛光连续设置，二者可通过滚筒输送机实现岩彩基板的输送。在一个实施方式中，通过砂光机完成所述第一次表面抛光和第二次表面抛光。如此，通过所述第一次表面抛光与第二次表面抛光有利于后续uv漆渗透处理的进行。

[0035] S4、对所述岩彩基板进行uv漆渗透处理。

[0036] 其中，通过uv漆渗透处理可实现抛光后的岩彩基板的表面孔洞的封闭。在一个实施方式中，采用uv漆渗透机对岩彩基板进行uv漆渗透处理，上述uv漆渗透机所使用的uv渗透漆的渗透用量可以为$60\pm5G/m^2$。

[0037] S5、对渗透处理之后的岩彩基板进行第一次干燥。

[0038] 其中，所述第一次干燥为流平干燥，所述流平干燥的干燥温度为60-70℃。优选地，所述流平干燥的干燥温度为65℃。

[0039] S6、对渗透处理之后的岩彩基板进行第二次干燥。

[0040] 其中，所述第二次干燥为uv干燥，所述uv干燥的干燥能量为1600-1700J。优选地，所述uv干燥的干燥能量为1650J。在一个实施方式中，采用5灯uv干燥机进行uv干燥。

[0041] S7、待岩彩板基板表面完全干燥后，对岩彩板基板进行水性加固处理。

[0042] 其中，通过水性加固喷涂设备进行水性加固处理。优选地，水性加固处理过程中的用量为$5\pm2G/m^2$。

[0043] S8、对水性加固之后的岩彩板基板进行第三次干燥处理，待其完全干燥后，进行第

一次底涂。

[0044] 其中，所述第三次干燥为流平干燥，所述流平干燥的干燥温度为60-70℃。优选地，所述流平干燥的干燥温度为65℃。在一个实施方式中，采用底漆涂布机进行第一次底涂。优选地，底漆涂布机的底涂用量为70±5G/m^2。

[0045] S9、对第一次底涂之后的岩彩板基板进行第四次流平干燥处理，待其完全干燥后，控制岩彩板基板进行换向，并对换向后的岩彩板基板进行第二次底涂。

[0046] 其中，所述第四次干燥为流平干燥，所述流平干燥的干燥温度为60-70℃。优选地，所述流平干燥的干燥温度为65℃。岩彩板基板进行换向时，通过翻转机构使其水平旋转180°，如此有利于所述岩彩板基板表面进行均匀的涂布。在一个实施方式中，采用底漆涂布机进行第二次底涂。优选地，底漆涂布机的底涂用量为70±5G/m^2。

[0047] S10、对第二次底涂之后的岩彩板基板进行烘干，并下料得到底涂的岩彩基板。

[0048] 其中，通过烘房进行对第二次底涂之后的岩彩板基板进行烘干，所述烘房的温度为55-65℃。

[0049] 基于如上所述的生产工艺，本发明还提供一种由该生产工艺得到的底涂的岩彩基板。

[0050] 综上所述，本发明能够对岩彩基板进行有效的加工处理，使其表面满足后续的加工需求，同时，本发明还具有连续性好、加工效率高的优点。

[0051] 对于本领域技术人员而言，显然本发明不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本发明。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。

[0052] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。